



技术平台

- ▶ 技术支撑平台简介
- ▶ 基因组与表观基因组学平台
- ▶ 分子细胞生物学平台
- ▶ 蛋白质组学平台
- ▶ 药物与结构学平台
- ▶ 多功能影像平台
- ▶ 生物信息学平台

蛋白质组学平台

[首页](#) > [技术平台](#) > [蛋白质组学平台](#)

2105C2微流控实验室

预约方法: 电话预约



主要技术指标

曝光时间调解器: 0.1至 999.9秒

曝光波长: 350-450nm

应用范围

生物芯片/微流控芯片

微机电器件

纳米压印

操作流程

- (1) 开机: 电源 (ON)
- (2) 设置曝光时间
- (3) 设置曝光能量
- (4) 曝光完毕禁止关闭机器电源, 必须10~15min后才能关闭机器电源 (机器需要散热)
- (5) 每次曝光灯管启动时间间隔3min左右 (即关灯后至少3min后才能再次开灯)

SU-8光刻胶制备方法

SU-8系列光刻胶是一种负性、环氧树脂型、近紫外线光刻胶, 具有垂直侧壁和高深宽比的厚膜图形性能, 还具有良好的力学性能、抗化学腐蚀性和热稳定性。SU-8在受到紫外辐射后发生交联, 是一种化学扩大负性胶, 可以形成台阶等结构复杂的图形, SU-8胶不导电, 在电镀时可以直接作为绝缘体使用。操作步骤如下:

- (1) 将SU-8光刻胶组分旋涂在基材上, 施涂厚度几至几百微米。涂覆晶片随后在95摄氏度下干燥20分钟并随后冷却至室温。
- (2) 将负光掩模与涂覆晶片接触, 一起放置到紫外曝光机中, 设置紫外辐射在剂量250mJ/cm²曝光。
- (3) 在95摄氏度下加热曝光后的晶片10分钟。
- (4) 在显影液中浸渍10分钟, 随后用水漂洗, 在空气中干燥并显影。

友情链接

[复旦常用站点](#) ▲

[复旦院系链接](#) ▲

[其他高校链接](#) ▲